

Echipament cu surse de plasma pentru procesarea materialelor in vid ultra-inalt prin magnetron-sputtering si e-beam ATC 2200 AJA INTERNATIONAL



Domeniu de utilizare:

Realizarea de straturi subtiri si nanostructuri din materiale conductive, materiale rezistive, semiconductori oxidici, izolatori.

Parametrii functionali:

- presiunea de baza min. 5×10^{-8} torr,
- presiunea de lucru in evaporare, 5×10^{-8} torr,
- sistem de joje de vid pentru intreg domeniul de vacuum: 760 - 5×10^{-9} torr,
- 4 surse pentru pulverizare in CC, CC pulsat si Radio Frecventa,
- evaporator cu fascicul de electroni in vid ultra-inalt (UHV) din 5 creuzete.